

ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ПЛЕНОК
ФЕРРИТ-ГРАНАТОВ

В.Н. Д у д о р о в, Н.Н. К у д е л ь к и н,
В.В. Р а н д о ш к и н

Ионная имплантация монокристаллических пленок феррит-гранатов (МПФГ) применяется для подавления жестких цилиндрических магнитных доменов (ЦМД) и создания продвигающих структур типа „соприкасающихся дисков” [1–3]. Она приводит к созданию в ионно-имплантированном слое (ИИС) анизотропии типа „легкая плоскость” [4]. Процесс перемагничивания в ионно-имплантированных МПФГ протекает иначе, чем в неимплантированных, и начинается возникновением неустойчивости в переходной области между ИИС и основным объемом МПФГ [5]. Импульсное перемагничивание ионно-имплантированных МПФГ в достаточно больших полях осуществляется путем неоднородного вращения намагниченности и „турбулентного” зарождения микродоменов [6].

В настоящей работе изучен процесс импульсного перемагничивания из насыщенного состояния ионно-имплантированных МПФГ состава $(Y, Sm, Lu, Ca)_3(Fe, Ge)_5O_{12}$, выращенных методом жидкофазной эпитаксии на подложках $Gd_3Ga_5O_{12}$ с ориентацией (111). Имплантацию проводили ионами He^+ с энергией 100 кэВ и дозой $2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$. В работе приводятся данные для образца с параметрами: толщина пленки $h = 6.6 \text{ мкм}$, характеристическая длина $l = 0.76 \text{ мкм}$, поле коллапса ЦМД $H_o = 116 \text{ Э}$, намагниченность насыщения $4\pi M_s = 266 \text{ Гс}$, поле одноосной магнитной анизотропии $H_k = 1550 \text{ Э}$, эффективное поле магнитной анизотропии в ИИС $H_{Ki} = 1590 \text{ Э}$, поле кубической магнитной анизотропии $H_{kii} = -600 \text{ Э}$. Характерным отличием исследованных образцов является достаточно высокая кубическая анизотропия ($|H_{k1}|/H_k \gtrsim 0.3$).

На установке высокоскоростной фотографии [7] в стробоскопическом режиме регистрировали домены с обратной намагниченностью (ДОН), зарождающихся при импульсном перемагничивании МПФГ из насыщенного состояния. В исходном состоянии образец намагничивали полем смещения $H_{CM} > H_o$, приложенным вдоль нормали к плоскости пленки. Импульсное магнитное поле H_u прикладывали в противоположном направлении и формировали с помощью плоской катушки диаметром $\sim 1.5 \text{ мм}$, расположенной на поверхности образца (длительности переднего и заднего фронтов импульса поля не превышали 15 нс). Заметим, что составляющая этого поля, параллельная плоскости пленки, оказывает ориентирующее влияние на намагниченность в ИИС.

Изображение динамической доменной конфигурации через 25 нс после начала выключения импульса магнитного поля амплитудой $H_{\text{и}} = 310$ Э и длительностью 300 сн при $H_{\text{см}} = 126$ Э (строскопический режим регистрации).

После приложения импульса магнитного поля, амплитуда которого вблизи витков катушки превышает пороговое поле неоднородного вращения намагниченности $H_{\text{вр}}$, перемагничивание начинается на периферии турбулентным зарождением микродоменов, причем граница неперемагниченной области имеет форму искаженного треугольника (внутри катушки формируется так называемый треугольный магнитный домен (ТМД) [8]).

Увеличение порогового поля $H_{\text{вр}}$ имеет место в направлениях $[2\bar{1}1]$, $[1\bar{1}\bar{2}]$ и $[1\bar{2}1]$ (вдоль этих направлений расстояние от центра катушки до границы неперемагниченной области максимальна), а вдоль направлений $[21\bar{1}]$, $[1\bar{1}2]$ и $[12\bar{1}]$ пороговое поле $H_{\text{вр}}$ понижается. Процесс перемагничивания завершается прорастанием ДОН по толщине МПФГ и движением границы ТМД.

После окончания импульса поля релаксация в исходное состояние также осуществляется турбулентным зарождением микродоменов (с исходной намагниченностью), причем оно начинается уже на заднем фронте импульса и локализовано в центре катушки (см. рисунок). Заметим, что при строскопической регистрации изображения доменов сливаются, поскольку процесс зарождения микродоменов является неповторяющимся. Отличие процесса перемагничивания, начинаящегося на заднем фронте импульса поля, состоит в том, что в процессе релаксации в исходное состояние зарождение микродоменов происходит также в узких областях. Наличие этих областей связано с формированием в ИИС в процессе действия импульса поля трех доменных стенок, исходящихся вблизи центра катушки и ориентированных вдоль направлений $[2\bar{1}1]$, $[1\bar{1}\bar{2}]$ и $[1\bar{2}1]$. Вследствие неоднородного распределения намагниченности в этих доменных стенках снижаются локальные поля зародышебразования. Увеличение порогового поля $H_{\text{вр}}$ вдоль указанных направлений в процессе действия импульса поля объясняется более высоким углом θ_m выхода вектора намагниченности в ИИС из плоскости МПФГ вдоль них.



$\otimes H_{\text{см}}$

Тот факт, что существование доменных стенок в ИИС приводит к снижению локальных полей зародышеобразования при импульсном перемагничивании ионно-имплантированных МПФГ, может быть положен в основу метода визуализации этих стенок. Несомненным преимуществом такого метода является, в частности, возможность исследования динамики заряженных доменных стенок, что не позволяет традиционный порошковый метод.

Список литературы

- [1] Эшенфельдер А. Физика и техника цилиндрических магнитных доменов. М.: Мир, 1983. 496 с.
- [2] Рандошкин В.В. // Радиоэлектроника за рубежом. 1983. В. 8. С. 1-34.
- [3] Элементы и устройства на цилиндрических магнитных доменах: Справочник. М.: Радио и связь, 1987. 488 с.
- [4] Дурасова Ю.А., Зюзин А.М., Куделькин Н.Н., Лю-фачун М.А., Осико В.В., Рандошкин В.В., Телеснин Р.В., Тимошечкин М.И. // Доклады АН СССР. 1984. Т. 277. В. 2. С. 363-366.
- [5] Куделькин Н.Н., Рандошкин В.В., Телеснин Р.В. // ЖТФ. 1984. Т. 54. В. 10. С. 2072-2074.
- [6] Рандошкин В.В., Червоненкис А.Я. Прикладная магнитооптика. М.: Энергоатомиздат, 1990. 320с.
- [7] Логунов М.В., Рандошкин В.В., Сигачев В.Б. / ПТЭ. 1985. № 5. С. 247-248.
- [8] Иванов Л.П., Логгинова А.С., Непокойчикский Г.А. / ЖЭТФ. 1983. Т. 84. В. 3. С. 1006-1021.

Институт
общей физики
АН СССР,
Москва

Поступило в Редакцию
7 декабря 1990 г.